(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



) PRATA BENJETON NI BERUTA KODIN BERUT BERUT BERUT AN DER BETUTA BENJET BENJET BUTA BENJET BENJET KODIN BERUTAN

(43) 国際公開日 2004年10月21日(21.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/089968 A1

(51) 国際特許分類7:

C07H 19/067

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005109

(22) 国際出願日:

2004年4月9日(09.04.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-106849 2003年4月10日(10.04.2003) Љ

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): セ ントラル硝子株式会社 (CENTRAL GLASS COM-PANY,LIMITED) [JP/JP]; 〒7550001 山口県宇部市大 字沖宇部 5 2 5 3 番地 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石井 章央 (ISHI, Akihiro) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川越市今福中台 2805番地 セントラル硝子株式会社 化学研究所内 Saitama (JP). 大塚 隆史 (OOTSUKA, Takashi) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川越市今福中台2805番地 セン トラル硝子株式会社 化学研究所内 Saitama (JP). 金井 正富 (KANAI, Masatomi) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川 越市今福中台2805番地 セントラル硝子株式会 社 化学研究所内 Saitama (JP). 栗山 克 (KURIYAMA, Yokusu) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川越市今福中台 2805番地 セントラル硝子株式会社 化学研究所内 Saitama (JP). 安本 学 (YASUMOTO, Manabu) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川越市今福中台2805番地 セン トラル硝子株式会社 化学研究所内 Saitama (JP). 伊野 宮 憲人 (INOMIYA, Kenjin) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県

川越市今福中台2805番地 セントラル硝子株式会 社 化学研究所内 Saitama (JP). 植田 浩司 (UEDA, Koji) [JP/JP]; 〒3501151 埼玉県川越市今福中台2805番 地 セントラル硝子株式会社 化学研究所内 Saitama (JP).

- (74) 代理人: 橋本 剛, 外(HASHIMOTO, Takeshi et al.); 〒1040044 東京都中央区明石町1番29号 掖済会ビ ル SHIGA内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING 2'-DEOXY-2'-FLUOROURIDINE

(54) 発明の名称: 2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造方法

(57) Abstract: 1-B-D-Arabinofuranosyluracil in a 3',5'-hydroxy-protected form is reacted with a trifluoromethanesulfonylating agent in the presence of an organic base to convert it into a 2'-triflate form, and this compound is reacted with a fluorinating agent comprising "a salt or complex comprising an organic base and hydrofluoric acid" to produce 2'-deoxy-2'-fluorouridine in a 3',5'-hydroxy-protected form. An agent for eliminating the protective groups is further caused to act on the protected compound to obtain 2'-deoxy-2'-fluorouridine. The 2'-deoxy-2'-fluorouridine obtained can be efficiently purified by temporarily converting it into a 3',5'-diacetyl form, recrystallizing the 3',5'-diacetyl form, and then deacetylating it. Thus, high-purity 2'-deoxy-2'-fluorouridine can be produced.

(57) 要約: $1-\beta-D-Pラピノフラノシルウラシルの <math>3'$ 、5'-水酸基保護体を有機塩基の存在下、トリフルオロメタ ンスルホニル化剤と反応させ、2-トリフレート体に変換し、次いで「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩また は錯体」よりなるフッ素化剤と反応させることにより、2ーデオキシ-2ーフルオロウリジンの3', 5ー水酸基保護 体を製造できる。さらに脱保護化剤を作用させることによって2ーデオキシ-2ーフルオロウリジンが得られる。得 られた2'-デオキシ-2'-フルオロウリジンは、一旦3'、5'-ジアセチル体に変換し、該3'、5'-ジアセチル体を再 結晶した後、脱アセチル化することにより、高純度の2′−デオキシ−2′−フルオロウリジンへと効率よく精製するこ とができる。

明 細 書

2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造方法

5 発明の背景

10

本発明は医薬の重要中間体である2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造方法に関する。

本発明で対象とする 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンは医薬の重要中間体である。従来の製造方法は次の二つに大別でき、代表的な文献を引用する。

- (1) 2, 2, -アンヒドロウリジンをフッ化水素酸で開環フッ素化する方法(非特許文献1(J. Org. Chem. (米国), 1964年, 第29巻, 第3号, p. 558-564)参照)。
- (2) 1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3', 5'-水酸
 15 基保護体をDAST ((C₂H₅)₂NSF₃) で脱ヒドロキシフッ素化する方法(非特許文献2 (Chem. Pharm. Bull.(日本), 1994年, 第42巻, 第3号, p. 595-598) 参照)。

また本発明に関連する技術として、2、一デオキシー2、一フルオロアデノシンおよび2、一デオキシー2、一フルオログアノシンの合20 成において、それぞれ対応する9ーβーDーアラビノフラノシルアデニンの3、5、一水酸基保護体およびN²ーイソブチリルー9ーβーDーアラビノフラノシルグアニンの3、5、一水酸基保護体を水素化ナトリウムの存在下、トリフルオロメタンスルホニルクロライドと反応されることにより、それぞれ対応する2、一トリフレート体に変換25 し、次いでテトラブチルアンモニウムフルオライド(TBAF)と反応させる方法が開示されている(非特許文献3(Tetrahedron Lett.(英国)、1977年、第18巻、第15号、p.12

91-1294)、非特許文献4 (Chem. Pharm. Bull. (日本), 1981年, 第29巻, 第4号, p. 1034-1038)、非特許文献5 (J. Carbohyd. Nucl. Nucl. (英国), 1980年, 第7巻, 第2号, p. 131-140)、非特許文献6 (Chem. Pharm. Bull. (日本), 1981年, 第29巻, 第11号, p. 3281-3285) 参照)。

5

20

非特許文献1に開示された、2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造方法では、腐食性が強いフッ化水素酸を高温下で過剰に用いて反応を行うため、反応器の材質に大幅な制限があった。また基質を反応溶媒で高度に希釈するため生産性が悪く、反応収率自体も低いものであった。さらに工業的な観点から見た場合、大量の取り扱いが困難なフッ化水素酸を使用し、また得られた生成物の精製にはカラムクロマトグラフィーを必要とするため、工業的な製造方法とは言い難いものであった。

15 一方、非特許文献 2 の製造方法では、工業的に高価で且つ大量の取り扱いに問題のある特殊なフッ素化剤を使用する必要があり、反応収率も中程度で、工業的な製造方法とは言い難いものであった。

また非特許文献3~6に開示された、2, ーデオキシー2, ーフルオロアデノシンまたは2, ーデオキシー2, ーフルオログアノシンの合成方法は、ごく低い収率でしか、目的物を与えなかった。

非特許文献3~6に開示されている、2, ートリフレート体をフッ素化し、2, ーデオキシー2, ーフルオロアデノシンもしくは2, ーデオキシー2, ーフルオログアノシンを得る反応は、フッ素アニオン(F⁻)による求核的なS_N2置換反応と考えられるが、この反応においては副反応として「トリフレート基(CF₃SO₃-基)の脱離反応」が競合して起こり、1, 位炭素と2, 位炭素が二重結合で結ばれた化合物を副生する。上記の非特許文献3における低収率の原因もこの副

反応に由来する。これはフッ素アニオン(F^-)による求核的な $S_N 2$ 置換反応に内在する本質的な問題であり、同様の問題は本発明の目的化合物 2 ' - デオキシー 2 ' - フルオロウリジンの製造にも当てはまる。

5 このように 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンを工業的に有利に製造する方法が強く望まれていた。

さらに、本願発明における最終目的化合物である 2 , ーデオキシー 2 , ーフルオロウリジンは水溶性で且つ難結晶性の化合物であるため、高純度な白色結晶性粉末として回収率良く精製するには、カラムクロマトグラフィーによる精製を必要とし(非特許文献 1、非特許文献 2)、精製操作に負荷がかかるものであった。再結晶精製のように簡便な精製操作で高純度な白色結晶性粉末として回収率良く精製できる方法は未だ報告されていない。このように 2 , ーデオキシー 2 , ーフルオロウリジンの工業的な精製方法も強く望まれていた。

15 発明の要約

10

20

本発明の目的は、医薬の重要中間体である2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの工業的な製造方法を提供することにある。

本発明のもう1つの目的は、2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの前駆体である2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の工業的な製造方法を提供することにある。

本発明は、式「1]

[式中、R は水酸基の保護基を表す]で示される $1-\beta-D-$ アラビノフラノシルウラシルの3′, 5′ー水酸基保護体を有機塩基の存在下、式 [2]

CF₃SO₂X [2]

5 [式中、XはF原子、C1原子またはCF₃SO₃基を表す]で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることにより、式[3]

[式中、Rは水酸基の保護基を表し、TfはCF₃SO₂基を表す]で 10 示される2'ートリフレート体に変換し、次いで「有機塩基とフッ化 水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤と反応させるこ とにより、式[4]

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される2'ーデオキシー2'15 ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を製造する第1方法を 提供する。

上記の第1方法は第2方法であってもよい。第2方法は、式[2]

で示される上記のトリフルオロメタンスルホニル化剤が式 [5] で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤である以外は、第1方法と同一である。

CF₃SO₂F [5]

5 さらに、上記の第1方法は第3方法であってもよい。第3方法にお いては、式[6]

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す]で示される $1-\beta$ -D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体をトリエチルアミンの存在下、式[5]

CF_3SO_2F [5]

10

で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることにより、式[7]

15 [式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表し、TfはCF₃SO₂ 基を表す]で示される2'ートリフレート体に変換し、次いで「トリ エチルアミンとフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ 素化剤と反応させることにより、式[8]

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体が製造される。

また本発明は、上記の第1~第3方法の何れかにより製造された、 式[4]

5

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' 10 ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' - 水酸基保護体、または式 [8]

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す] で示される2'ー

デオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を脱保 護化剤と反応させることにより、式[9]

で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンを製造する第 4 5 方法を提供する。

また本発明は、式[9]

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンを有機塩基の存在下、アセチル化剤と反応させることにより、式 [10]

10

[式中、Acはアセチル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体に変換し、次いで該2'

ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体を再結晶精製し、さらに脱アセチル化剤と反応させることから成る、式[9]

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンを精製するための第5方法を提供する。

第5方法は第6方法であってもよい。第6方法は、式[9]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンが第4方法により製造されたものであること以外は、第5方法と同一である。

詳細な説明

5

10 本発明者らは上記の課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、本発明で対象とする $1-\beta-D-$ アラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体を基質とした場合に、目的とする2, 位でのトリフルオロメタンスルホニル化、および引き続く2, 位でのフッ素アニオン(F^-)による求核的な $S_N 2$ 置換反応が、特定の条件下、良好に進行することを明らかにした。

本発明の特に重要な点は、2²ートリフレート体のフッ素化工程におけるフッ素化剤として、「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」を用いることにある。

前記のように、フッ素アニオン(F^-)による求核的な $S_N 2$ 置換反 20 応においては、副反応としてトリフレート基($CF_3SO_3^-$ 基)の脱離 反応が競合する。しかし本発明者らは、この脱離反応が、上記の非特 許文献 $3\sim 6$ で使用された強塩基性のフッ素化剤であるテトラブチル

アンモニウムフルオライド (TBAF) を、フッ素アニオン (F⁻) の求核性が比較的高く且つ塩基性の弱いフッ素化剤である、「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」に代えることにより、高度に抑制できることを明らかにした。

5 さらに本発明者らは、このフッ素化剤として、「ピリジンまたはトリエチルアミンとフッ化水素酸からなる、塩または錯体」が特に好ましいことを見出した。

特に、工業的に安価に市販されており且つ取り扱いが比較的安全な、「トリエチルアミン1モルとフッ化水素酸3モルからなる錯体((C_2 10 H_5) $_3$ N・3 H_5)」および、「ピリジン約30%(約10モル%)とフッ化水素酸約70%(約90モル%)からなる錯体(商品名: \sim 10 E0モル%E10 E10 E10 E10 E10 E10 E10 E10 E10 E11 E11 E11 E12 E11 E12 E12 E13 E14 E16 E16 E16 E17 E17 E18 E18 E18 E18 E19 E18 E18 E19 E19 E18 E19 E19

特にトリエチルアミン 1 モルとフッ化水素酸 3 モルからなる錯体 $((C_2H_5)_3N \cdot 3HF)$ はガラス製反応容器を使用しても失透や腐食等の問題が起こらないため、反応容器の材質の点からも特に有利である。

20

25

従来の技術(非特許文献 3~6)における 2 , ーデオキシー 2 , ーフルオロアデノシンおよび 2 , ーデオキシー 2 , ーフルオログアノシンの合成では、何れもフッ素化剤としてテトラブチルアンモニウムフルオライド(TBAF)が用いられていた。この場合、過剰に使用したTBAFや、水との後処理操作で生成するテトラブチルアンモニウムヒドロキシド((n-Bu) 4NOH)を生成物から選択的に取り除くことは一般的に難しい。ところが上記のフッ素化剤を使用した場合には、水洗等の簡単な精製操作で過剰に使用したフッ素化剤を生成物から選択的に取り除くことができ、工業的な生産時における大幅な操作性の向上が達成された。

さらに、本発明においては、2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造における3'位および5'位の水酸基の保護化剤に関する、新たな知見が得られた。

3,位および5,位の水酸基の保護化剤としては、2,一デオキシ
5 -2,一フルオロアデノシンおよび2,一デオキシー2,一フルオログアノシンの合成における脱保護化工程において、3,位および5,位の水酸基の保護基はテトラヒドロフラニル基(THF基)の方がテトラヒドロピラニル基(THP基)よりも優れていることが開示されている(非特許文献4、非特許文献5)。しかしながらテトラヒドロフランは、アトラヒドロピラニル基(THF基)の保護化剤である2,3一ジヒドロフランは、テトラヒドロピラニル基(THP基)の保護化剤である3,4一ジヒドロー2Hーピランに比べて沸点が低いため(54℃ vs.86℃)取り扱いが困難で、さらに工業的により高価である。

ところが本発明で対象とする2'ーデオキシー2'ーフルオロウリ 15 ジンの製造においては、3'位および5'位の水酸基の保護基がテトラヒドロピラニル基(THP基)であっても脱保護化工程が良好に進行することが明らかになった。

このTHP基を保護基として用いた場合に中間体として生成する、式[7]で示される「3'位および5'位の水酸基がテトラヒドロピ ラニル基(THP基)で保護された2'ートリフレート体」は新規化合物であり、2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの工業的な製造方法における好適な中間体である。

さらに本発明においては、 $1-\beta-D-T$ ラビノフラノシルウラシルの 3 ',5 ' - 水酸基保護体の 2 ' 位水酸基のトリフルオロメタンスルホニル化反応において、トリフルオロメタンスルホニルフルオライド(CF_3SO_2F)が好適に使用できることを明らかにした。

25

2'位水酸基に対するトリフルオロメタンスルホニル化剤としては、

トリフルオロメタンスルホン酸無水物((CF_3SO_2) $_2O$)を使用しても反応は進行するが、トリフルオロメタンスルホン酸無水物((CF_3SO_2) $_2O$)は二つのトリフルオロメタンスルホニル基(CF_3SO_2 基)を持つが、反応に利用されるのは一つであり、残りはトリフレート基(CF_3SO_3 ⁻基)の形で脱離基として働く。従って原子経済性の観点から言えば、トリフルオロメタンスルホン酸無水物((CF_3SO_2) $_2O$)の使用は必ずしも効率的ではない。

5

20

一連のトリフルオロメタンスルホン酸誘導体の工業的な製造方法をスキーム1に示す。このフローの中で、トリフルオロメタンスルホニルフルオライド(CF_3SO_2F)はより上流に位置しており、トリフルオロメタンスルホニルフルオライド(CF_3SO_2F)を使用することが工業的には最も有利である。

このような背景を踏まえて鋭意検討を行った結果、本発明で対象とする1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体のトリフルオロメタンスルホニル化において、トリフルオロメタ25 ンスルホニルフルオライド (CF₃SO₂F)を使用しても反応が良好に進行することが見出された。この結果、上記の問題点、つまり(1)トリフルオロメタンスルホニル基 (CF₃SO₂基)の利用率の低さ、

(2) 2,位に塩素原子が置換した化合物の副生、を本質的に回避できることとなった。また、このトリフルオロメタンスルホニル化反応には、塩基を共存させる必要があるが、塩基としては、工業的に高価で且つ発火の危険性がある水素化ナトリウムを使用する必要がなく、工業的に安価で且つ取り扱いが安全なピリジンやトリエチルアミン等の有機塩基を使用することが可能である。

5

スキーム1

さらに本発明者らは、得られた2'ーデオキシー2'ーフルオロウ リジンの新規な精製方法を見出した。すなわち、2,一デオキシー2, ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体の易結晶性に着目し、 10 2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの低純度品を一度3',5' ージアセチル体に誘導し、この3',5'ージアセチル体を再結晶精製 することにより純度を高め、再び脱アセチル化することにより高純度 の2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンに精製できることを明ら かにした。このようにして得られた 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロ 15 ウリジンはアモルファスにはならず、高純度な白色結晶性粉末として 収率良く回収できる。このように、カラムクロマトグラフィーによる 精製のような負荷のかかる精製方法を回避しつつ、高純度な白色結晶 性粉末として2,一デオキシー2,一フルオロウリジンが得られるこ 20 とを明らかにした。

最後に本発明の製造方法は各反応工程ともに選択性が高く分離の難しい不純物を殆ど副生しないことから、第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程と第二工程のフッ素化工程をワンポットの反応として行うことができ、また第三工程の脱保護化工程と第四工程のアセ

チル化工程をワンポットの反応として行うこともでき、2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンを工業的に製造するための極めて有用な方法である。

以下、本発明の2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの製造方 法について詳細に説明する。本発明はスキーム2で示されるように、 (1)トリフルオロメタンスルホニル化工程、(2)フッ素化工程、(3) 脱保護化工程、(4)アセチル化工程、(5)再結晶精製工程、(6)脱アセチル化工程の六つの製造工程からなる。

- まず、第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程について詳細に説明する。第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程は、式[1]で示される1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3',
 5'-水酸基保護体を有機塩基の存在下、式[2]で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることにより達する。
- 15 出発原料である式 [1] で示される $1-\beta-D-アラビノフラノシ$ ルウラシルの3, 5, 水酸基保護体のR としては、トリチル基(トリフェニルメチル基)、テトラヒドロピラニル基(THP 基)、テトラ

ヒドロフラニル基(THF基)等が挙げられる。その中でもテトラヒドロピラニル基(THP基)およびテトラヒドロフラニル基(THF基)が好ましく、特にテトラヒドロピラニル基(THP基)がより好ましい。式[1]で示される化合物は非特許文献2および、Khim.

5 Geterotsikl. Soedin. (ロシア), 1996年, 第7号, p. 975-977、を参考にして製造することができる。これらの文献の方法にならえば、3'位と5'位を選択的に保護したものが得られる。

式 [2] で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤としては、
10 トリフルオロメタンスルホニルフルオライド (CF_3SO_2F) 、トリフルオロメタンスルホニルクロライド (CF_3SO_2C1) 、トリフルオロメタンスルホン酸無水物 $((CF_3SO_2)_2O)$ が挙げられる。その中でもトリフルオロメタンスルホニルフルオライド (CF_3SO_2F) およびトリフルオロメタンスルホン酸無水物 $((CF_3SO_2)_2O)$ が好ましく、特にトリフルオロメタンスルホニルフルオライド (CF_3SO_2F) がより好ましい。

式 [2] で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤の使用量としては、式 [1] で示される $1-\beta-D-$ アラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体1モルに対して1モル以上使用すればよく、通常は $1\sim2$ 0モルが好ましく、特に $1\sim1$ 0モルがより好ましい。

20

有機塩基としては、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソ プロピルエチルアミン、トリnーブチルアミン、ジメチルラウリルア ミン、4ージメチルアミノピリジン、N, Nージメチルアニリン、ジ 25 メチルベンジルアミン、1,5ージアザビシクロ[4,3,0]ノン ー5ーエン、1,8ージアザビシクロ[5,4,0]ウンデセー7ー エン、1,4ージアザビシクロ[2,2,2]オクタン、ピリジン、

2, 4-ルチジン、2, 5-ルチジン、2, 6-ルチジン、3, 4-ルチジン、3,5-ルチジン、2,4,6-トリメチルピリジン、イ ミダゾール、ピリミジン、ピリダジン等が挙げられる。その中でもト リエチルアミンおよびピリジンが好ましく、特にトリエチルアミンが より好ましい。

5

有機塩基の使用量としては、式[1]で示される1-β-D-アラ ビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体1モルに対して通 常1モル以上使用すればよく、2~20モルが好ましく、特に3~1 0 モルがより好ましい。

- 反応溶媒としては、特に使用しなくても反応を行うことはできるが、 10 使用することが好ましい。かかる反応溶媒としては、nーペンタン、 n-ヘキサン、シクロヘキサン、n-ヘプタン等の脂肪族炭化水素系、 ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、メシチレン等の芳 香族炭化水素系、塩化メチレン、クロロホルム、1, 2-ジクロロエ タン等のハロゲン化炭化水素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ 15 ラン、 t ーブチルメチルエーテル、1, 4 - ジオキサン等のエーテル 系、酢酸エチル、酢酸nーブチル等のエステル系、ヘキサメチルリン 酸トリアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルア セトアミド、Nーメチルピロリドン等のアミド系、アセトニトリル、
- プロピオニトリル等のニトリル系、ジメチルスルホキシド等が挙げら 20 れる。その中でもトルエン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、酢 酸エチル、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、アセトニトリルおよびジメチルスルホキシドが好ましく、特 に塩化メチレン、N, N-ジメチルホルムアミドおよびアセトニトリ ルがより好ましい。これらの反応溶媒は単独または組み合わせて使用 25
- することができる。

反応溶媒の使用量としては、式 [1] で示される $1-\beta-D-アラ$

ビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体1モルに対して通常0.1 L以上使用すればよく、0.1~20 Lが好ましく、特に0.1~10 Lがより好ましい。

温度条件としては、通常、-100~+50℃であり、-80~+20℃が好ましく、特に-60~-10℃がより好ましい。式 [2]で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤の内、トリフルオロメタンスルホニルフルオライド(CF_3SO_2F)を使用して沸点(-21℃)以上の温度条件で反応を行う場合には耐圧反応容器を使用することができる。

5

10 反応時間としては、通常 O. 1~24時間であるが、基質および反応条件により異なるため、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、NMR等の分析手段により反応の進行状況を追跡して原料が殆ど消失した時点を終点とすることが好ましい。

後処理としては、特に制限はないが、通常は反応終了液に水、炭酸 15 水素ナトリウム水溶液または食塩水等を加え、トルエン、塩化メチレ ンまたは酢酸エチル等の有機溶媒で抽出し、回収有機層を水または食 塩水等で洗浄し、無水硫酸ナトリウムまたは無水硫酸マグネシウム等 の乾燥剤で乾燥し、濾過し、濃縮し、真空乾燥し、粗生成物を得るこ とができる。必要に応じて粗生成物を活性炭処理または再結晶等の精 製操作に付すことにより、目的の式[3]で示される2'ートリフレ 20 ート体を高い化学純度で得ることができる。しかしながら本2'ート リフレート体は反応性が高いため、後処理操作を行い系外に単離する ことなく、反応終了液に直接、「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩 または錯体」よりなるフッ素化剤を加えて、第一工程のトリフルオロ メタンスルホニル化工程と第二工程のフッ素化工程をワンポットの反 25 応として行うことが有効である。さらに有機塩基と「有機塩基とフッ 化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤の存在下、式

[2]で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤を加えて、第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程と第二工程のフッ素化工程をワンポットの反応として行うことも有効である。また式[2]で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤としてトリフルオロメタンスルホニルフルオライド(CF₃SO₂F)を用いた場合には、反応の進行に伴い「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」を副生するが、引き続くフッ素化反応は殆ど進行せず、新たに「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤を加える必要がある。

5

10 次に第二工程のフッ素化工程について詳細に説明する。第二工程のフッ素化工程は、第一工程で得られた、式[3]で示される2'ートリフレート体を「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤と反応させることにより達する。

「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ 素化剤における有機塩基としては、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、トリローブチルアミン、ジメチルラウリルアミン、4ージメチルアミノピリジン、N, Nージメチルアニリン、ジメチルベンジルアミン、1, 5ージアザビシクロ[4, 3, 0]ノンー5ーエン、1, 8ージアザビシクロ[5, 4, 0]ウンデセー7ーエン、1, 4ージアザビシクロ[2, 2, 2]オクタン、ピリジン、2, 4ールチジン、2, 5ールチジン、2, 6ールチジン、3, 4ールチジン、3, 5ールチジン、2, 4, 6ートリメチルピリジン、イミダゾール、ピリミジン、ピリダジン等が挙げられる。その中でもトリエチルアミンおよびピリジンが好ましく、特にトリエチルアミンがより好ましい。

フッ素化剤における有機塩基とフッ化水素酸のモル比としては、通常、100:1~1:100の範囲であり、50:1~1:50の範

囲が好ましく、特に $25:1\sim1:25$ の範囲がより好ましい。さらにアルドリッチ (Aldrich、2003-2004総合カタログ)から市販されている、「トリエチルアミン1モルとフッ化水素酸3モルからなる錯体 ((C_2H_5) $_3$ N・3HF)」および、「ピリジン約30% (約10モル%)とフッ化水素酸約70% (約90モル%)からなる錯体(商品名: ~10 モル% C_5H_5 N・ ~90 モル%HF)」を使用するのが極めて便利である。

5

「有機塩基とフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ 素化剤の使用量としては、式[3]で示される2'ートリフレート体 10 1モルに対して通常1モル以上使用すればよく、1~20モルが好ま しく、特に1~10モルがより好ましい。

反応溶媒としては、特に使用しなくても反応を行うことはできるが、 使用することが好ましい。かかる反応溶媒としては、nーペンタン、 n-ヘキサン、シクロヘキサン、n-ヘプタン等の脂肪族炭化水素系、 ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、メシチレン等の芳 15 香族炭化水素系、塩化メチレン、クロロホルム、1,2ージクロロエ タン等のハロゲン化炭化水素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ ラン、t-ブチルメチルエーテル、1, 4-ジオキサン等のエーテル 系、酢酸エチル、酢酸n-ブチル等のエステル系、ヘキサメチルリン 20 酸トリアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルア セトアミド、N-メチルピロリドン等のアミド系、アセトニトリル、 プロピオニトリル等のニトリル系、ジメチルスルホキシド等が挙げら れる。その中でもトルエン、塩化メチレン、テトラヒドロフラン、酢 酸エチル、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセト アミド、アセトニトリルおよびジメチルスルホキシドが好ましく、特 25 に塩化メチレン、N, N-ジメチルホルムアミドおよびアセトニトリ ルがより好ましい。これらの反応溶媒は単独または組み合わせて使用

することができる。

10

反応溶媒の使用量としては、式[3]で示される2'ートリフレート体1モルに対して通常0.1 L以上使用すればよく、0.1~20 Lが好ましく、特に0.1~10Lがより好ましい。

5 温度条件としては、通常-100~+100℃であり、-80~+ 80℃が好ましく、特に-60~+60℃がより好ましい。

反応時間としては、通常 0.1~120時間であるが、基質および 反応条件により異なるため、ガスクロマトグラフィー、液体クロマト グラフィー、NMR等の分析手段により反応の進行状況を追跡して原 料が殆ど消失した時点を終点とすることが好ましい。

後処理としては、特に制限はないが、通常は反応終了液に水、炭酸水素ナトリウム水溶液、炭酸カリウム水溶液または食塩水等を加え、トルエン、塩化メチレンまたは酢酸エチル等の有機溶媒で抽出し、回収有機層を水または食塩水等で洗浄し、無水硫酸ナトリウムまたは無水硫酸マグネシウム等の乾燥剤で乾燥し、濾過し、濃縮し、真空乾燥し、粗生成物を得ることができる。必要に応じて粗生成物を活性炭処理または再結晶等の精製操作に付すことにより、目的の式[4]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を高い化学純度で得ることができる。

20 次に第三工程の脱保護化工程について詳細に説明する。第三工程の 脱保護化工程は、第二工程で得られた、式 [4]で示される 2'ーデ オキシー 2'ーフルオロウリジンの 3', 5'ー水酸基保護体を脱保護 化剤と反応させることにより達する。

脱保護化反応は脱保護化剤に酸触媒を使用することが好ましく、ア 25 ルコール系の反応溶媒中で行うことが好ましい。

酸触媒としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホ

ン酸、p-hルエンスルホン酸、PPTS(ピリジニウムp-hルエンスルホネート)、10-hンファースルホン酸等の有機酸、Amber1 y s t H-15、Dowex 50W-X8等のイオン交換樹脂、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸等の無機酸が挙げられる。その中でも酢酸、p-hルエンスルホン酸、塩酸および硫酸が好ましく、特にp-hルエンスルホン酸および硫酸がより好ましい。

5

10

酸触媒の使用量としては、式 $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$ で示される $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$ ・デオキシー $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$ ・フルオロウリジンの $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$ ・ 一水酸基保護体通常、 $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ モルに対して触媒量以上使用すればよく、 $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ ・ $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ ・ $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ ・ $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ ・ $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$ ・ $\begin{bmatrix} 0$

反応溶媒としては、アルコール系の反応溶媒を使用することが好ましく、かかる反応溶媒としては、メタノール、エタノール、nープロパノール、iープタノール、iーブタノール、secーブタノール、tertーブタノール等が挙げられる。その中でもメタノール、エタノール、nープロパノールおよびnーブタノールが好ましく、特にメタノール、エタノールおよびnープロパノールがより好ましい。これらの反応溶媒は単独または組み合わせて使用することができる。

反応溶媒の使用量としては、式 [4]で示される 2 ' ーデオキシー 20 2 ' ーフルオロウリジンの 3', 5' ー水酸基保護体 1 モルに対して 通常 0.1 L以上使用すればよく、 0.1 ~ 20 Lが好ましく、特に 0.1 ~ 10 Lがより好ましい。

温度条件としては、通常、-20~+100℃であり、-10~+80℃が好ましく、特に0~+60℃がより好ましい。

25 反応時間としては、通常、0.1~48時間であるが、基質および 反応条件により異なるため、薄層クロマトグラフィー、液体クロマト グラフィー、NMR等の分析手段により反応の進行状況を追跡して原

料が殆ど消失した時点を終点とすることが好ましい。

5

15

後処理としては、特に制限はないが、通常は反応終了液に有機塩基または無機塩基を加え、アルコール系の反応溶媒を濃縮することにより、目的の式[9]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの粗生成物を得ることができる。第四工程のアセチル化反応は、本粗生成物をアセチル化剤と反応させることにより、十分良好に進行する。

次に第四工程のアセチル化工程について詳細に説明する。第四工程 のアセチル化工程は、第三工程で得られた、式[9]で示される2,

10 ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンを有機塩基の存在下、アセチル 化剤と反応させることにより達する。

アセチル化剤としては、無水酢酸、アセチルフルオライド、アセチルクロライド、アセチルブロマイド等が挙げられる。その中でも無水酢酸、アセチルクロライドおよびアセチルブロマイドが好ましく、特に無水酢酸およびアセチルクロライドがより好ましい。

アセチル化剤の使用量としては、式 [9] で示される 2 $^{\prime}$ ーデオキシー 2 $^{\prime}$ ーフルオロウリジン 1 モルに対して、通常 2 モル以上使用すればよく、 2 ~ 2 0 モルが好ましく、特に 2 ~ 1 0 モルがより好ましい。

有機塩基としては、トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、トリnーブチルアミン、ジメチルラウリルアミン、4ージメチルアミノピリジン、N, Nージメチルアニリン、ジメチルベンジルアミン、1, 5ージアザビシクロ [4, 3, 0] ノンー5ーエン、1, 8ージアザビシクロ [5, 4, 0] ウンデセー7ー25 エン、1, 4ージアザビシクロ [2, 2, 2] オクタン、ピリジン、2, 4ールチジン、2, 5ールチジン、2, 6ールチジン、3, 4ールチジン、3, 5ールチジン、2, 4, 6ートリメチルピリジン、イ

ミダゾール、ピリミジン、ピリダジン等が挙げられる。その中でもト リエチルアミンおよびピリジンが好ましく、特にピリジンがより好ま しい。

有機塩基の使用量としては、式[9]で示される2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジン1モルに対して通常2モル以上使用すればよく、2~20モルが好ましく、特に2~10モルがより好ましい。

反応溶媒としては、n ーペンタン、n ーヘキサン、シクロヘキサン、 n ーヘプタン等の脂肪族炭化水素系、ベンゼン、トルエン、エチルベ ンゼン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素系、塩化メチレン、

- 10 クロロホルム、1,2ージクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、tーブチルメチルエーテル、1,4ージオキサン等のエーテル系、酢酸エチル、酢酸nーブチル等のエステル系、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン
- 第のアミド系、アセトニトリル、プロピオニトリル等のニトリル系、 ジメチルスルホキシド等が挙げられる。その中でもトルエン、塩化メ チレン、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、N, Nージメチルホルム アミド、N, Nージメチルアセトアミド、アセトニトリルおよびジメ チルスルホキシドが好ましく、特に塩化メチレンおよびN, Nージメ
- 20 チルホルムアミドがより好ましい。これらの反応溶媒は単独または組み合わせて使用することができる。またアセチル化剤と有機塩基を過剰量用いて反応溶媒を兼ね合わせることもできる。

温度条件としては、通常-20~+100 \mathbb{C} であり、-10~+80 \mathbb{C} が好ましく、特に0~+60 \mathbb{C} がより好ましい。

25 反応時間としては、通常、0.1~48時間であるが、反応条件により異なるため、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、 NMR等の分析手段により反応の進行状況を追跡して原料が殆ど消失

した時点を終点とすることが好ましい。

5

10

後処理としては、特に制限はないが、通常は反応終了液中の過剰に使用したアセチル化剤および有機塩基と反応溶媒を濃縮し、濃縮残査に水を加え、析出した結晶を濾過し、水、またはトルエン、塩化メチレンまたは酢酸エチル等の有機溶媒で洗浄し、真空乾燥することにより、目的の式[10]で示される2、一デオキシー2、一フルオロウリジンの3、5、一ジアセチル体の粗結晶を得ることができる。

次に第五工程の再結晶精製工程について詳細に説明する。第五工程の再結晶精製工程は、第四工程で得られた、式[10]で示される2、 ーデオキシー2、一フルオロウリジンの3、5、一ジアセチル体の粗 結晶を再結晶精製することにより達する。

再結晶溶媒としては、nーペンタン、nーヘキサン、シクロヘキサ ン、n-ヘプタン等の脂肪族炭化水素系、ベンゼン、トルエン、エチ ルベンゼン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素系、塩化メチ レン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水 15 素系、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、tーブチルメチルエ ーテル、1,4-ジオキサン等のエーテル系、アセトン、メチルエチ ルケトン、メチルi-ブチルケトン等のケトン系、酢酸エチル、酢酸 n-ブチル等のエステル系、アセトニトリル、プロピオニトリル等の 20 ニトリル系、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロ パノール、nーブタノール、iーブタノール等のアルコール系、水等 が挙げられる。その中でもn-ヘキサン、n-ヘプタン、塩化メチレ ン、テトラヒドロフラン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチ ル、アセトニトリル、メタノール、エタノール、n-プロパノール、 iープロパノールおよび水が好ましく、特にnーヘプタン、アセトン、 25 アセトニトリル、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノールおよび水がより好ましい。これらの再結晶溶媒は単独ま

たは組み合わせて使用することができる。

5

10

15

20

再結晶溶媒の使用量としては、式 [10] で示される 2' ーデオキシー 2' ーフルオロウリジンの 3', 5' ージアセチル体の粗結晶 1g に対して、通常 1m1 以上使用すればよく、 $1\sim100m1$ が好ましく、特に $1\sim50m1$ がより好ましい。

本再結晶精製においては、種結晶を加えることにより円滑に且つ効率良く結晶を析出させることができる。種結晶の使用量としては、式[10]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体の粗結晶1gに対して通常0.0001g以上使用すればよく、0.0001~0.1gが好ましく、特に0.001~0.05gがより好ましい。

温度条件としては、使用する再結晶溶媒の沸点および凝固点により 適宜決めることができ、通常は約30℃から再結晶溶媒の沸点付近の 温度で精製前の粗結晶を溶解し、静置下または撹拌下、徐々に降温し ながら結晶を析出させ、最終的には-20℃〜室温(25℃)まで冷 却する。^

本再結晶精製においては、析出した結晶の化学純度が向上するため、 析出した結晶を濾過等で回収することにより、高い化学純度の式 [1 0]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5' ージアセチル体を得ることができる。また本再結晶操作を繰り返すこ とにより、さらに高い化学純度のものを得ることができる。また精製 前の粗結晶を再結晶溶媒に溶解した溶液を活性炭処理することにより 脱色することもできる。

精製時間としては、通常、0.1~120時間であるが、精製条件 25 により異なるため、析出した結晶の化学純度および結晶の析出量をモニター分析して高い化学純度で収率良く回収できた時点を終点とすることが好ましい。

最後に第六工程の脱アセチル化工程について詳細に説明する。第六 工程の脱アセチル化工程は、第五工程で得られた、高い化学純度の式 [10]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3', 5'ージアセチル体を脱アセチル化剤と反応させることにより達する。 脱アセチル化反応は脱アセチル化剤に酸触媒または塩基を使用する ことが好ましく、アルコール系の反応溶媒中で行うことが好ましい。

5

10

酸触媒としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、PPTS(ピリジニウムpートルエンスルホネート)、10ーカンファースルホン酸等の有機酸、Amberlyst H-15、Dowex 50W-X8等のイオン交換樹脂、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸等の無機酸が挙げられる。その中でも酢酸、pートルエンスルホン酸、塩酸および硫酸が好ましく、特に

15 酸触媒の使用量としては、式 [10]で示される 2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジンの 3', 5'ージアセチル体の高純度品 1 モル に対して触媒量以上使用すればよく、通常は 0.01~100モルが 好ましく、特に 0.03~50モルがより好ましい。

pートルエンスルホン酸および塩酸がより好ましい。

塩基としては、メチルアミン、エチルアミン、nープロピルアミン、1ープロピルアミン、nーブチルアミン、iーブチルアミン、secーブチルアミン、tertーブチルアミン、nーペンチルアミン、nーペシルアミン、シクロヘキシルアミン等の炭素数1から6の低級アルキルー級アミン、アンモニア等が挙げられる。その中でもメチルアミン、エチルアミン、nープロピルアミン、nーブチルアミンおよびアンモニアが好ましく、特にメチルアミン、エチルアミンおよびアンモニアがより好ましい。

塩基の使用量としては、式[10]で示される2'ーデオキシー2'

ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体の高純度品1モルに対して、通常2モル以上使用すればよく、2~200モルが好ましく、特に2~100モルがより好ましい。

反応溶媒としては、アルコール系の反応溶媒を使用することが好ましく、かかる反応溶媒としては、メタノール、エタノール、nープロパノール、iープロパノール、iーブタノール、iーブタノール、secーブタノール、tertーブタノール等が挙げられる。その中でもメタノール、エタノール、nープロパノールおよびnーブタノールが好ましく、特にメタノール、エタノールおよびnープロパノールが10 より好ましい。これらの反応溶媒は単独または組み合わせて使用することができる。

反応溶媒の使用量としては、式 [10]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体の高純度品1モルに対して、通常0.1 L以上使用すればよく、0.1~20 Lが好ましく、特に0.1~10 Lがより好ましい。

15

温度条件としては、通常-20~+100℃であり、-10~+80 +80

20 反応時間としては、通常 O. 1~120時間であるが、反応条件により異なるため、薄層クロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、 NMR等の分析手段により反応の進行状況を追跡して原料が殆ど消失 した時点を終点とすることが好ましい。

後処理としては、特に制限はないが、通常は反応終了液中の過剰に 25 使用した酸触媒および塩基と反応溶媒を濃縮し、高純度な白色結晶性 粉末を収率良く回収することができる。必要に応じて高純度な白色結 晶性粉末を活性炭処理または再結晶等の精製操作に付すことにより、

目的の式 [9] で示される 2' ーデオキシー 2' ーフルオロウリジンをさらに高い化学純度で得ることができる。特に塩基としてアンモニアを使用した場合に副生するアセトアミドは再結晶精製により効率的に除くことができる。本再結晶精製は第五工程の再結晶精製工程を参考にして同様に行うことができる。この場合に、式 [10] で示される 2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジンの 3', 5'ージアセチル体の粗結晶を、式 [9] で示される 2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジンの高純度な白色結晶性粉末に読み替えて行う。

以下、実施例により本発明の実施の形態を具体的に説明するが、本 10 発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[参考例1]

出発原料である $1-\beta-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-$ 水酸基保護体の製造

ガラス製反応容器に、下記式

15

で示される2,2'-アンヒドロウリジン 50.00g(0.221 mol、leq)、N,N-ジメチルホルムアミド 320mlと3,4-ジヒドロー2H-ピラン 129.08g(1.534mol、6.94eq)を加え、0℃に冷却し、p-トルエンスルホン酸・一水和20 物 25.60g(0.135mol、0.61eq)を加え、室温で18時間50分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が98.1%で、下記式

で示される 2 、 2 ' - アンヒドロウリジンの 3 ' , 5 ' - 水酸基保護体が生成していることを確認した。反応終了液にトリエチルアミン 1 3 . 0 7 g(0 . 1 2 9 m o 1 、 0 . 5 8 e q)を加え、0 \sim に冷却し、2 N 水酸化ナトリウム水溶液 2 3 0 m 1(0 . 4 6 0 m o 1 、2 . 0 8 e q)を加え、室温で 2 時間 1 5 分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が 9 8 . 7 % で、下記式

5

10

15

で示される $1-\beta-D-P$ ラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体が生成していることを確認した。反応終了液に酢酸 29. 37g (0. 489mol, 2. 21eq) と水 200mlを加え、酢酸エチル 250mlで抽出した。回収水層はさらに酢酸エチル 150mlで2回抽出した。回収有機層は、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下濃縮し、少量のトルエンで3回共沸し、上記式で示される $1-\beta-D-P$ ラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体の粗生成物 196.12gを得た。粗生成物の回収量は理論収率の重量 91.15gを超えていた。

[実施例1]

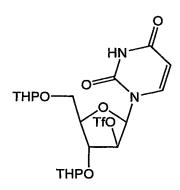
第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程と 第二工程のフッ素化工程

SUS製耐圧反応容器に、[参考例1]で製造した、下記式

5

10

で示される $1-\beta-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体の粗生成物 142.90g(0.145<math>mo1$ とする、1eq)、N,N-ジメチルホルムアミド 290<math>m1とトリエチルアミン 87.12g(0.861mo1、5.94eq)を加え、内温を-54 \mathbb{C} に冷却し、トリフルオロメタンスルホニルフルオライド 45.00g(0.296mo1、2.04eq)を加え、撹拌しながら2時間30分かけて-20 \mathbb{C} まで昇温した。反応終了液を $^{19}F-NMR$ で分析したところ、下記式



15 で示される2'ートリフレート体が生成していることを確認した。2' ートリフレート体の ¹⁹F - NMRスペクトルを下に示す。

¹⁹F-NMR (基準物質: C₆F₆, 溶媒: CDCl₃)、δ ppm:8

7. 06, 87. 09, 87. 17, 87. 20.

反応終了液に-20°Cで $(C_2H_5)_3$ N・3 H F 1 1 8 . 0 0 g (0 . 7 3 2 m o 1 、5 . 0 5 e q) を加え、室温で6 2 時間 4 5 分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が>99%で、下記式

5

10

15

20

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体が生成していることを確認した。反応終了液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。回収水層はさらに酢酸エチルで抽出した。回収有機層は、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下濃縮し、上記式で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の粗生成物 177.18gを得た。粗生成物の回収量は理論収率の重量 60.09gを超えていた。2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の19FーNMRスペクトルを下に示す。

¹⁹F-NMR (基準物質: C₆F₆, 溶媒: CDCl₃)、δ ppm:-43.13 (dt, 51.9Hz, 15.4Hz), -42.50 (dt, 51.5Hz, 15.4Hz), -37.62 (dt, 51.5Hz, 15.0Hz), -37.62 (dt, 51.5Hz).

[実施例2]

第三工程の脱保護化工程と第四工程のアセチル化工程

ガラス製反応容器に、[実施例1]で製造した、下記式

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の粗生成物 177.18g(0.145molとする、1eq)、メタノール 150mlとpートルエンスルホン酸・一水和物 13.80g(0.073mol、0.50eq)を加え、室温で16時間30分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が99.0%で、下記式

5

10 で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンが生成していることを確認した。反応終了液にピリジン 6.88g(0.087mol.0.60eq)を加え、減圧下濃縮し、上記式で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの粗生成物を得た。

ガラス製反応容器に粗生成物全量を加え、0℃に冷却し、ピリジン 15 68.46g(0.865mol、5.97eq)と無水酢酸 54. 10g(0.530mol、3.66eq)を加え、室温で19時間 10分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したと

ころ、変換率が>99%で、下記式

5

10

で示される 2 ' - デオキシー 2 ' - フルオロウリジンの 3 ', 5 ' - ジアセチル体が生成していることを確認した。反応終了液を 5 0 $\mathbb C$ で減圧下濃縮し、濃縮残査に水 8 0 m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 1 e m 2 e m 2 e m 2 e m 2 e m 2 e m 2 e m 3 e m 3 e m 4 m 4 m

¹H-NMR (基準物質: TMS, 溶媒: DMSO-D₆)、δ ppm:
1.96 (s, 3H), 2.03 (s, 3H), 4.08 (dd, 5.

15 6Hz, 12.0Hz, 1H), 4.19 (ddd, 2.4Hz, 5.6Hz, 8.0Hz, 1H), 4.26 (dd, 2.4Hz, 12.0Hz, 1H), 5.18 (ddd, 5.2Hz, 8.0Hz, 17.6Hz, 1H), 5.46 (ddd, 2.0Hz, 5.2Hz, 52.4Hz, 1H), 5.61 (d, 8.0Hz, 1H), 5.79 (dd, 2.0Hz, 1H), 5.61 (d, 8.0Hz, 1H), 5.79 (dd, 2.0Hz, 12.1H), 7.64 (d, 8.0Hz, 1H), 11.41 (br, 1H).

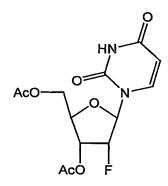
¹⁹F-NMR(基準物質:C₆F₆,溶媒:DMSO-D₆)、δ ppm:

-35.34 (dt, 51.9Hz, 21.4Hz).

[実施例3]

第五工程の再結晶精製工程

ガラス製反応容器に、[実施例2]で製造した、下記式



5

で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ージアセチル体の粗結晶 5 8.00g、メタノール 3 3 0 m l と水 1 2 0 m l を加え、還流条件下で加熱溶解し、撹拌しながら室温まで降温した。析出した結晶を濾過し、メタノールで洗浄し、真空乾燥し、上10 記式で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ージアセチル体の高純度品 3 3.4 8 g を得た。1 ー β ー D ー ア ラ ビノフラノシルウラシルの 3 ', 5 ' ー 水酸基保護体の粗生成物から 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ージアセチル体の高純度品までのトータル収率は 7 0 %であった(理論収率の重量 4 7.15 8 9 g)。高純度品を液体クロマトグラフィーで分析したところ、H P L C純度が 9 9.4 9 %であった。

5' -ジアセチル体の二回目再結晶品までのトータル収率は66%であった(理論収率の重量 47.89g)。二回目再結晶品を液体クロマトグラフィーで分析したところ、HPLC純度が99.95%であった。

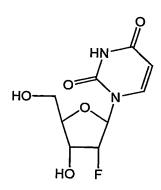
5

[実施例4]

第六工程の脱アセチル化工程

SUS製耐圧反応容器に、[実施例3]で製造した、下記式

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージ 10 アセチル体の二回目再結晶品 5.00g(15.14mmol、1eq)、メタノール50mlとアンモニア 12.89g(756.90mmol、49.99eq)を加え、室温で6時間30分撹拌した。 反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が99.9%で、下記式



15

で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンが生成している ことを確認した。

反応終了液を減圧下濃縮し、高純度な白色結晶性粉末 6.77gを得た。ガラス製反応容器に、高純度な白色結晶性粉末 6.77g、iープロパノール 70m1とnーヘプタン 3m1を加え、還流条件下で加熱溶解し、撹拌しながら室温まで降温した。析出した結晶を濾過し、iープロパノールで洗浄し、真空乾燥し、上記式で示される2・ーデオキシー2・ーフルオロウリジンのさらに高純度な白色結晶性粉末 3.10gを得た。脱アセチル化反応と再結晶精製のトータル収率は83%であった。ルアセチル化反応と再結晶精製のトータル収率は83%であった。1ーβーローアラビノフラノシルウラシルの3・、5・一水酸基保護体の粗生成物から2・ーデオキシー2・ーフルオロウリジンの再結晶品を液体クロマトグラフィーで分析したところ、HPLC純度が99.84%であった。2・ーデオキシー2・ーフルオロウリジンの「H、19F-NMRスペクトルを下に示す。

¹H-NMR (基準物質: TMS, 溶媒: DMSO-D₆)、δ ppm:

3.57 (d, 12.8 Hz, 1H), 3.75 (d, 12.8 Hz, 1H), 3.86 (d, 7.6 Hz, 1H), 4.13 (ddd, 4.4 Hz, 7.6 Hz, 20.8 Hz, 1H), 5.02 (ddd, 2.0 Hz, 4.4 Hz, 53.2 Hz, 1H), 5.20 (br-t, 1H), 5.61 (br, 1H), 5.61 (dd, 2.0 Hz, 8.0 Hz, 1H), 5.89 (dd, 2.0 Hz, 17.6 Hz, 1H), 7.91 (d, 8.0 Hz, 1H), 11.38 (br-d, 1H).

¹⁹F-NMR (基準物質: C₆F₆, 溶媒: DMSO-D₆)、δ ppm: -39.77 (dt, 51.5 Hz, 18.4 Hz).

[実施例5]

第六工程の脱アセチル化工程

ガラス製反応容器に、[参考例1]および[実施例1]から[実施例3]を参考にして同様に製造した、下記式

で示される 2 ' - デオキシー 2 ' - フルオロウリジンの 3 ', 5 ' - ジアセチル体の高純度品 199.00g(0.603mol、1eq、HPLC純度 <math>99.60%)とメタノール 4020mlを加え、<math>60%で1時間撹拌した。内温を 55%に冷却し、2.11M塩酸メタノール 200ml(0.422mol,0.70eq)を加え、<math>45%で19時間撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が >99.5%で、下記式

5

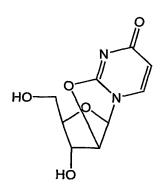
10 で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンが生成していることを確認した。反応終了液を濾過し、減圧下濃縮し、高純度な白色結晶性粉末 196.38gを得た。ガラス製反応容器に、高純度な白色結晶性粉末 196.38g、iープロパノール 900mlとnーヘプタン 300mlを加え、50℃で30分間加熱攪拌洗浄し、室温15 まで降温した。析出した結晶を濾過し、真空乾燥し、上記式で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンのさらに高純度な白色結晶性粉末 137.51gを得た。脱アセチル化反応と加熱攪拌洗浄の

トータル収率は93%であった。加熱攪拌洗浄品を液体クロマトグラフィーで分析したところ、HPLC純度が99.50%であった。2,ーデオキシー2,ーフルオロウリジンの¹H, ¹⁹FーNMRスペクトルは[実施例4]に示したものと同様であった。

[参考例2]

出発原料である $1-\beta-D-$ アラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体の製造

ガラス製反応容器に、N, N-ジメチルホルムアミド 700m1と3,4-ジヒドロー2H-ピラン 235.00g(2.794mo1、10 4.00eq)を加え、0℃に冷却し、p-トルエンスルホン酸・一水和物 80.00g(0.421mol、0.60eq)を加え、さらに同温度にて、下記式



5

で示される2,2'-アンヒドロウリジン 158.00g(0.69 15 9mol、1eq)を加え、室温で15時間35分撹拌した。反応終 了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が99.3% で、下記式

で示される 2 、 2 、 2 ・ 2

5

で示される $1-\beta-D-アラビノフラノシルウラシルの3$, 5, -水酸基保護体が生成していることを確認した。反応終了液に酢酸 89. 10 17g(1.485mol、2.12eq)を加え、酢酸エチル 45 0mlで抽出した。回収水層はさらに酢酸エチル 200mlで抽出した。回収水層はさらに酢酸エチル 200mlで抽出した。回収有機層は、減圧下濃縮し、上記式で示される $1-\beta-D-$ アラビノフラノシルウラシルの3, 5, -水酸基保護体の粗生成物 479.94gを得た。粗生成物の回収量は理論収率の重量 288.2 15 9gを超えていた。

[実施例6]

第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程と

第二工程のフッ素化工程

SUS製耐圧反応容器に、[参考例2]で製造した、下記式

で示される1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水 酸基保護体の粗生成物 479.94g(0.699molとする、1 eq)、アセトニトリル 880mlとトリエチルアミン 428.34g(4.233mol、6.06eq)を加え、0℃に冷却し、(C2H5)3N・3HF 451.00g(2.797mol、4.00eq)を加え、さらに冷却し、内温-23~-45℃にて、トリフルオロメ タンスルホニルフルオライド 191.00g(1.256mol、1.80eq)を加え、室温で110時間55分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が99.8%で、下記式

15 で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ー水酸基保護体が生成していることを確認した。炭酸カリウム 350.0 0g(2.532mol、3.62eq)を水 3000mlに溶解し、

酢酸エチル 800m1を加えて調製した二相系溶液に、反応終了液を 攪拌しながら加え、酢酸エチルで抽出した。回収水層はさらに酢酸エ チル 500m1で抽出した。回収有機層は、減圧下濃縮し、上記式で 示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸 基保護体の粗生成物 794.54gを得た。粗生成物の回収量は理論 収率の重量 289.69gを超えていた。2'ーデオキシー2'ーフ ルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の19FーNMRスペクトル は[実施例1]に示したものと同様であった。

[実施例7]

10 第三工程の脱保護化工程と第四工程のアセチル化工程 ガラス製反応容器に、[実施例 6]で製造した、下記式

5

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体の粗生成物 794.54g(0.699molとする、115 eq)、メタノール 700mlとpートルエンスルホン酸・一水和物66.60g(0.350mol、0.50eq)を加え、室温で40時間30分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が100%で、下記式

5

10

で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンが生成していることを確認した。反応終了液にピリジン 88.02g(1.113mol、1.59eq)を加え、減圧下濃縮し、上記式で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの粗生成物を得た。

ガラス製反応容器に粗生成物全量を加え、ピリジン 489.00g (6.182mol,8.84eq) を加え、0 \mathbb{C} に冷却し、無水酢酸 541.00g (5.299mol,7.58eq) を加え、室温で40分撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が96.6%で、下記式

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体が生成していることを確認した。反応終了液を減圧下濃縮し、濃縮残査を0℃に冷却し、水 160mlと酢酸エチル 160ml5 lを加え、同温度にて攪拌し、析出した結晶を濾過し、真空乾燥し、上記式で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体の粗結晶 175.36gを得た。2,2'ーアンヒド

ロウリジンから 2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジンの 3', 5'ージアセチル体の粗結晶までのトータル収率は 7 6 %であった(理論収率の重量 230.86g)。粗結晶を液体クロマトグラフィーで分析したところ、HPLC純度が 96.90%であった。 2'ーデオキシー 2'ーフルオロウリジンの 3', 5'ージアセチル体の ¹H, ¹9FーNMRスペクトルは [実施例 2] に示したものと同様であった。

[実施例8]

第五工程の再結晶精製工程

ガラス製反応容器に、[実施例7]で製造した、下記式

10

. 5

で示される 2 ' ーデオキシー 2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ージアセチル体の粗結晶 175.36gとアセトニトリル 700mlを加え、還流条件下で加熱溶解し、撹拌しながら室温まで降温した。析出した結晶を濾過し、真空乾燥し、上記式で示される 2 ' ーデオキシー2 ' ーフルオロウリジンの 3 ', 5 ' ージアセチル体の高純度品 143.22gを得た。2,2' ーアンヒドロウリジンから 2 ' ーデオキシー2' ーフルオロウリジンの 3 ',5' ージアセチル体の高純度品までのトータル収率は62%であった(理論収率の重量 230.86g)。高純度品を液体クロマトグラフィーで分析したところ、HPLC20純度が99.80%であった。

[実施例9]

第一工程のトリフルオロメタンスルホニル化工程と

第二工程のフッ素化工程

ガラス製反応容器に、[参考例1]を参考にして同様に製造した、下 記式

で示される1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体の粗生成物 0.412g(0.999mmolとする、1eq)、N,N-ジメチルホルムアミド 5mlとトリエチルアミン 0.799g(7.896mmol、7.90eq)を加え、-78℃に冷却し、トリフルオロメタンスルホン酸無水物 0.335g(1.187mmol、1.19eq)を加え、-78℃で10分間撹拌した。反応終了液を ¹⁹F-NMRで分析したところ、下記式

で示される 2 ' ートリフレート体が生成していることを確認した。 2 ' ートリフレート体の 19 F - NMR スペクトルは [実施例 1] に示した ものと同様であった。

反応終了液に-78℃で「ピリジン~30% (~10モル%) とフッ化水素酸~70% (~90モル%) からなる錯体 (~10モル% C₅

 H_5N ・~90モル%HF)」 0.2 m l を加え、室温で3時間撹拌した。反応終了液を液体クロマトグラフィーで分析したところ、変換率が62%で、下記式

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水 5 酸基保護体が生成していることを確認した。反応終了液に飽和炭酸水 素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。回収有機層は、 無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下濃縮し、上記式で示さ れる2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保 護体の粗生成物 0.816gを得た。粗生成物の回収量は理論収率の 10 重量 0.414gを超えていた。そこでカラムクロマトグラフィー(シ リカゲル/酢酸エチル: n - ヘキサン=1:1) による精製操作に付 し、精製品の正確な重量を測定したところ、精製品 0.324gを得 た。1-β-D-アラビノフラノシルウラシルの3', 5'-水酸基保 護体の粗生成物から2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3', 15 5'-水酸基保護体の精製品までのトータル収率は78%であった。 2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3', 5'ー水酸基保護体 の 19F-NMRスペクトルは [実施例1] に示したものと同様であっ た。

20

請 求 の 範 囲

1. 式[1]

CF_3SO_2X [2]

[式中、XはF原子、C1原子またはCF₃SO₃基を表す]で示され 10 るトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることにより、式 [3]

[式中、Rは水酸基の保護基を表し、TfはCF₃SO₂基を表す]で示される2'-トリフレート体に変換し、次いで「有機塩基とフッ化 水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤と反応させることにより、式[4]

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を製造する方法。

5 2. 式[1]

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される $1-\beta-D-アラビノフラノシルウラシルの<math>3$,5,-水酸基保護体をトリエチルアミンの存在下、式[5]

10 CF₃SO₂F [5]

で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることにより、式[3]

[式中、Rは水酸基の保護基を表し、TfはCF $_3$ SO $_2$ 基を表す]で示される2'ートリフレート体に変換し、次いで「トリエチルアミンとフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤と反応させることにより、式 [4]

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を製造する方法。

10 3. 式[6]

5

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す] で示される1-β

-D-アラビノフラノシルウラシルの3',5'-水酸基保護体をトリエチルアミンの存在下、式[5]

CF_3SO_2F [5]

で示されるトリフルオロメタンスルホニル化剤と反応させることによ 5 り、式 [7]

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表し、Tfは CF_3SO_2 基を表す〕で示される 2 ' ートリフレート体に変換し、次いで「トリエチルアミンとフッ化水素酸からなる、塩または錯体」よりなるフッ素化剤と反応させることにより、式 [8]

10

15

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を製造する方法。

4. 請求項1、請求項2および請求項3の何れかの方法により製造した、式[4]

[式中、Rは水酸基の保護基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体、または式[8]

5 [式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ー水酸基保護体を脱保 護化剤と反応させることにより、式[9]

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンを製造する方法。

5. 式[9]

10

で示される 2 , ーデオキシー 2 , ーフルオロウリジンを有機塩基の存在下、アセチル化剤と反応させることにより、式 [10]

5 [式中、Acはアセチル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体に変換し、次いで該2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体を再結晶精製し、さらに脱アセチル化剤と反応させることを特徴とする、式[9]

10

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの精製方法。

6. 請求項4の方法により製造した、式[9]

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンを有機塩基の存在下、アセチル化剤と反応させることにより、式[10]

5

[式中、Acはアセチル基を表す]で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体に変換し、次いで該2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの3',5'ージアセチル体を再結晶精製し、さらに脱アセチル化剤と反応させることを特徴とする、

10 式[9]

で示される2'ーデオキシー2'ーフルオロウリジンの精製方法。

7. 式[7]

[式中、THPはテトラヒドロピラニル基を表し、Tfは CF_3SO_2 5 基を表す] で示される 2 ' ートリフレート体。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

A CLASSICION OF GUIDIECE MATERIA		CT/JP2004/005109
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07H19/067		
According to International Patent Classification (IPC) or to both nation	nal classification and IPC	
B. FIELDS SEARCHED	······································	
Minimum documentation searched (classification system followed by c Int.Cl ⁷ C07H19/067	lassification symbols)	
Documentation searched other than minimum documentation to the ext	ent that such documents are inclu	uded in the fields searched
Electronic data base consulted during the international search (name of	data hase and where practicable	gearch terms word)
WPI(DIALOG), BIOSIS(DIALOG), CAS(STN))	, search terms used)
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·
Category* Citation of document, with indication, where a		
A Yoshiko SATO et al., "Synthes Anti-Human Immunodeficiency of N3-Substituted 2'-Deoxy-2' Chem.Pharm.Bull., Vol.42, 199	Virus-1 Activities '-fluorouridines".	
A JP 1-272595 A (Central Glass 31 October, 1989 (31.10.89), & US 5013828 A & DE & GB 5013828 A	3913039 A	1-7
	4816575 A 2100721 A	1-7
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See notent family annual	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 		
Date of the actual completion of the international search 12 July, 2004 (12.07.04)	Date of mailing of the international search report 03 August, 2004 (03.08.04)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No. orm PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005109

). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	Morio IKEHARA et al., "Studies on Nucleosides and Nucleotides. LXXXIX. Purine Cyclonucleosides. (43) Synthesis and Properties of 2'-Halogeno-2' -deoxyguanosines", Chem.Pharm.Bull., Vol.29, 1981, pages 3281 to 3285	1-7
A	Morio IKEHARA et al., "Studies on Nucleosides and Nucleotides. LXXXVII. Purine Cyclonucleosides. XLII. Synthesis of 2'-deoxy-2'-fluoroguanosines", Chem.Pharm.Bull., Vol.29, 1981, pages 1034 to 1038	
	·	
	(continuation of second sheet) (January 2004)	

A 500 EE CO	P-T-Y AME -		
A. 発明の Int. C)属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) :1 ⁷ C07H19/067		
1	00/1119/00/		
1			
	4		
B. 調査を	行った分野		
開館を行った	最小限資料(国際特許分類(IPC)) 1 ⁷ C07H19/067		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1111.0	1 CO/H19/067		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
1			
1			
		·	
国際調査で使	用した電子データベース(データベースの名利	、調査に使用した用語)	
WPI (D)	IALOG), BIOSIS (DIALOG), CAS (STN)		
 			
C. 関連す	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*			関連する
	11/4/211/11 人口 日内の国/月7/月里りる	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	Yoshiko Sato et al., "Synthesis a	and Hypnotic and Anti-Human	1-7
!	Immunodeficiency Virus-1 Activit	ies of N3-Substituted 2'-Dec] - '
	xy-2'-fluorouridines" Chem. Pharm	n. Bull., 第42巻, 1994 p. 595-598	
		!	
A	JP 1-272595 A (セントラル硝子株式	弌会社)1989.10.31	1-7
	& US 5013828 A & DE 3913039 A &	GB 5013828 A	. .
A j	JP 57-102889 A (東洋醸造株式会社) 1982, 6, 26	1-7
	& US 4613666 A & US 4816575 A &	DE 3148363 A & GB 2100721 A	1 1
		and the second of the second o	
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	年を参照
* 31 E ++ +	. l. v		和文化 《
* 引用文献の		の日の後に公表された文献	
************************************	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す		れた文献であって
「E」国際出原	月日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、発 の理解のために引用するもの	閉の原理又は理論
以後に公	>表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当	飲か夢のたる祭明
「し」優先権主	張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	られるもの
マ帝 しく	は他の特別な理由を確立するために引用する理由を付す)	「Y」特に関連のある文献であって、当	該文献と他の1以
「〇」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって自	明である組合せに
「P」国際出願	目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	もの
		「こころ」は「スプントンテミリー文献	
国際調査を完了		国際調査報告の発送日	
	12. 07. 2004	03. 8.	2004
国際調本拠期の			
日本国	名が及びめて先 特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員)	4C 9050
郵	便番号100-8915	加藤浩	<u></u>
東京都	千代田区設が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3450

C (続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A .	Morio Ikehara et al., "Studies on Nucleosides and Nucleotides. LXXXIX. Purine Cyclonucleosides. (43) Synthesis and Properties of 2'-Halogeno-2'-deoxyguanosines" Chem. Pharm. Bull., 第29巻, 1981 p. 3281-3285	1-7	
A	Morio Ikehara et al., "Studies on Nucleosides and Nucleotides. LXXXVII. Purine Cyclonucleosides. XLII. Synthesis of 2'-deoxy-2'-fluoroguanosines" Chem. Pharm. Bull., 第29巻, 1981 p. 1034-1038	1-7	
		:	
	,		
	, ·		
	•		